

開示の要約

平行な電子ビームを出射する電子ビーム源と、電子ビームの経路中に配置され、開口を有する試料用マスクと、試料を保持して移動するステージとを備え、試料用マスクは試料の表面に近接して配置され、試料用マスクの開口を通過した電子ビームで、試料の表面に前記開口に対応するパターンを露光する、電子ビーム近接露光装置で使用される試料用マスクの製作方法であって、試料用マスクと同一パターンの開口を有するマスタマスクを製作する工程と、マスタマスクを使用してマスタマスクと同一開口パターンを電子ビーム近接露光方法で露光して子マスクを製作する工程と、を備え、子マスクが試料用マスクとして使用されることを特徴とする方法。これにより、低コストで電子ビーム近接露光用のマスクを製作する方法が実現される。